

# [優良賞] ガスボンベを用いない希薄標準ガス調製装置



代表取締役社長  
松野 洌氏

株式会社 ガステック

〒252-1195 神奈川県綾瀬市深谷中8-8-6

TEL. 0467 (79) 3900

<http://www.gastec.co.jp/>



分析・計測技術、および環境影響評価の研究分野で必要不可欠な有害ガスの希薄標準ガスの簡便な発生・調製装置。水溶性の高い有害ガスなどをppmレベルの低濃度で再現性よく、安定に発生できる。

希薄ガスを発生する拡散スクラバーガス発生管は、多孔質テフロンチューブを内管とし、その外側にガラス管を被せたシンプルな2重管構造。ガス発生溶液をセットして空気を多孔質テフロンチューブ内に流すだけで、ガス発生溶液中のガス成分が多孔質テフロンチューブの孔を通過し、ppmレベルの希薄ガスが一定濃度で長時間発生する。スイッチオンで空気がガス発生装置に導入されると、希薄ガスが簡単に発生し、スイッチオフでガス発生はストップする。高圧ガスボンベとは異なり、簡単・安全にガスの発生を扱えるため、様々な分野での使用が見込まれる。

慶應義塾大学理工学部田中茂教授の研究成果を基に製品化。